



# 电子设备行业专题研究：断供风险加剧 高端光刻胶迎国产化良机



## 【投资要点】

光刻胶是晶圆制造重要材料，行业壁垒高。光刻胶是晶圆制造重要材料，承担“图形转移”重任。光刻胶种类繁多，专用性强。光刻的线宽极限和精度决定了集成电路的集成度、可靠性和成本，因此摩尔定律推动光刻胶技术不断加速迭代。同时光刻胶行业具备技术、客户、设备及原料四大高壁垒。

光刻胶市场不断扩容，高端光刻胶亟需国产替代。随着下游半导体、LCD 和 PCB 三大领域的高速发展，Reportlinker 数据预计光刻胶市场亦将持续扩容，2022 年有望超百亿。我国光刻胶产品以中低端为主，技术难度较高的半导体领域的 KrF、ArF 光刻胶则几乎全部依赖进口，被日美垄断，亟需国产替代。

以史为鉴产业链协同是关键，全产业链自主可控进步加速国产化。复盘日本光刻胶产业崛起关键因素为上下游协同发展，对比我国光刻胶全产业链自主可控不断突破：1) 下游伴随半导体和 LCD 产业不断向国内转移，驱动配套光刻胶需求提升。2) 中游政策不断利好，国内企业进入高端光刻胶量产和规模出货阶段，国产化加速。3) 上游原料和设备虽然被外企垄断，但国内部分企业积极投入研发，已有所突破，全产业链自主可控进步将加速光刻胶国产替代。

外企断供风险加剧，高端光刻胶迎来国产发展良机。今年 11 月份市场有消息称美国杜邦、陶氏、德国 AZ、日本 TOK 或将断供包括高端光刻

胶 KrF、ArF 在内的部分半导体材料。日美企业厂商占据国内高端光刻胶市场大部分份额，一旦断供，国内多家晶圆厂或将面临光刻胶缺货风险，将主动或被动的快速导入国产光刻胶，国内企业迎来高端光刻胶国产替代良机。

### 【配置建议】

行业投资策略上我们建议关注：（1）光刻胶研发突破；（2）光刻胶品类扩展；（3）光刻胶产能规划；（4）光刻胶原材料自主可控进展；（5）光刻机突破情况。

建议关注标的：推荐关注具备先发优势和产业链一体化优势的企业：

华懋科技，彤程新材，晶瑞电材，南大光电，上海新阳【风险提示】

技术突破不及预期

客户进展不及预期

政策风险超预期

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_50702](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_50702)

